

## 第十届全国分子束外延学术会议征文通知（第二轮）

会议时间：2013年8月20日—22日

会议地点：上海

报到时间：2013年8月19日

主办单位：中国有色金属学会半导体材料学术委员会

中国电子学会电子材料分会

承办单位：中国科学院上海微系统与信息技术研究所

信息功能材料国家重点实验室

承办单位地址：上海市长宁路865号（邮编：200050）

会议主席：齐 鸣

会议副主席：何 力，曾一平，陈 弘

### 顾问委员会

主 任：李爱珍

委 员（以姓氏笔划为序）：

孔梅影，王 迅，王 曦，王占国，王启明，王康隆，任迪远，李晋闽，陈良惠，  
何 杰，杨 辉，杨乃彬，杨克武，杨国祯，杜武青，卓以和，陆 卫，郑厚植，  
周均铭，赵连城，封松林，谢 琪，薛其坤

### 程序委员会

主 任：张永刚

副主任：陈建新，蒋最敏，曹俊诚

委 员（以姓氏笔划为序）：

马文全，于广辉，王文新，王玉琦，王志明，王庶民，王建农，牛智川，刘峰奇，  
刘新宇，李佛晓，沈大伟，金 智，罗 毅，武一斌，徐士杰，徐彭寿，龚 谦，  
谢茂海，雷震霖

## 组织委员会

主任：谢晓明

副主任：徐安怀

委员：曹建楠，殷之嵩，宋巨峰，陶雯君，顾 溢，李耀耀，艾立鹞，孙 浩

## 会议宗旨：

全国分子束外延学术会议是每两年举办一次的全国性学术会议。会议的宗旨是展示我国在分子束外延（MBE）及其相关领域的新进展、新动态、新成果，交流和探讨我国分子束外延发展中存在的问题和未来的发展方向，拓宽分子束外延的应用领域，为我国从事分子束外延技术以及相关材料和器件研究的科研人员提供相互了解和交流的机会，同时也为分子束外延相关的上下游产业提供信息沟通和宣传的渠道，从而促进我国分子束外延技术及其相关领域科学技术的发展。本届会议由中国有色金属学会半导体材料学术委员会和中国电子学会电子材料分会共同主办，中国科学院上海微系统与信息技术研究所及信息功能材料国家重点实验室承办。会议定于 2013 年 8 月 20 日—22 日在上海召开。会议将邀请国内外 MBE 领域著名专家学者作大会邀请报告和专题邀请报告，并组织国内外同行进行口头报告和墙报交流。本次会议将遴选出部分优秀论文发表于《功能材料与器件学报》，热烈期待全国科研院所、高等院校、公司企业所有参与 MBE 及相关工作的人员踊跃参加会议，积极投稿，同时也特别欢迎与分子束外延技术相关的产品、设备、测试分析仪器等领域的科研技术人员积极参会，凡是与会议主题相关的论文均可投稿。

## 征文范围：

- 1、分子束外延生长理论、技术
- 2、低维材料生长、分析研究
- 3、IV 族外延材料生长
- 4、III/V 族外延材料生长及相关器件研究
- 5、II/VI 族外延材料生长及相关器件研究
- 6、稀磁半导体材料及自旋电子学
- 7、太赫兹材料与器件

8、基于分子束外延技术的相关外延技术、新材料、新器件等

**征文要求:**

1. 论文要求反映国内外最新研究动态和成果,重点突出、层次分明、论述严谨、数据真实,且未在国内外公开刊物或其他学术会议上发表。
2. 论文可先投摘要,待审定录用后再投全文。论文摘要需注明论文题目、作者姓名、单位、通讯地址、主要结果等。论文编辑采用 A4 页面,标题用三号黑体,作者用四号字,其余用五号字,除标题外字体统一用宋体,包括图标在内每篇论文摘要不超过 2 个页面。会议统一接受电子文档投稿。
3. 论文请以电子邮件附件形式发送到会议投稿信箱:  
联系人: 张永刚  
E-mail: MBE2013ZYG@mail.sim.ac.cn
4. 论文投稿截止日期: 2013 年 5 月 31 日

为了促进分子束外延相关设备、分析测试仪器、原材料等方面的发展、宣传企业产品和文化,会议组委会欢迎各企事业单位以各种方式赞助本届会议,对于赞助本届会议的单位,将在会议文集显著版面上刊登赞助单位和名称。欲给与赞助的单位和公司请与会议组委会联系。

联系人: 徐安怀

联系电话: 021-62511070 转 8202, 13816793332

E-mail: MBE2013XAH@mail.sim.ac.cn

**第十届全国分子束外延学术会议组委会**

**2013 年 3 月 15 日**